

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 56-161538
(43)Date of publication of application : 11.12.1981

(51)Int.Cl. G03C 1/71
G03C 1/68
G03F 7/10
// C08F 2/48
H01L 21/302

(21)Application number : 55-064779 (71)Applicant : MITSUBISHI CHEM IND LTD
(22)Date of filing : 16.05.1980 (72)Inventor : NAGASAKA HIDEKI

(54) PHOTORESISTIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an image with superior chemical resistance by making combined use of a photocrosslinking type polymer having cinnamic acid groups in the principal or side chain and a polymerizable monomer having an ethylenic unsatd. bond to facilitate the peeling development of a photosensitive resist and inhibit O₂ from hindering photopolymn.

CONSTITUTION: A photosensitive composition is prepared by combining a 30W 95wt% photocrosslinking type polymer such as a polycondensate of phenylenediacrylic acid or its alkyl ester and polyol having cinnamic acid groups in the principal or side chain or a homo- or copolymer of the esterification product of polyepichlorohydrin or the like and cinnamic acid or cinnamate with a 70W5wt% polymerizable monomer such as (meth)acrylic ester, pentaerythritol triacrylate having an ethylenic unsatd. bond. The composition is used as a photoresist for forming a lithographic plate, an electronic circuit, etc. The sensitivity of this superior resist is not hindered by O₂, etc. in air.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑯ 日本国特許庁 (JP) ⑯ 特許出願公開
 ⑯ 公開特許公報 (A) 昭56-161538

⑯ Int. Cl. ³ G 03 C 1/71 1/68 G 03 F 7/10 // C 08 F 2/48 H 01 L 21/302	識別記号 101	府内整理番号 6791-2H 6791-2H 7267-2H 6505-4J 6741-5F	⑯ 公開 昭和56年(1981)12月11日 発明の数 1 審査請求 未請求
--	-------------	---	--

(全 5 頁)

⑯ 感光性組成物

⑯ 特願 昭55-64779
 ⑯ 出願 昭55(1980)5月16日
 ⑯ 発明者 長坂英樹

大和市つきみ野三丁目12番3号
 ⑯ 出願人 三菱化成工業株式会社
 東京都千代田区丸の内2丁目5
 番2号
 ⑯ 代理人 弁理士 長谷川一 外1名

明細書

1 発明の名称 感光性組成物

2 特許請求の範囲

- (1) (a) 主鎖または側鎖に桂皮酸基を有する光架橋型重合体 30～95重量%、および、(b) 重合可能なエチレン性不飽和結合を有する単量体 20～5重量%を含有することを特徴とする感光性組成物。
- (2) 重合可能なエチレン性不飽和結合を有する単量体が、アクリル酸エステル類またはメタクリル酸エステル類である特許請求の範囲第1項記載の組成物。
- (3) 重合可能なエチレン性不飽和結合を有する単量体が、ペンタエリスリトルトリアクリレートである特許請求の範囲第1項記載の組成物。

3 発明の詳細な説明

本発明は光重合可能な感光性組成物に関するものであり更に詳しくは秀れた光硬化特性を有する感光性組成物に関するものである。

従来、感光性樹脂に関する報告は極めて多數にのぼり、例えば光架橋型、光重合型、光分解型、光分解架橋型等に分類される種々の化合物が知られている。これら感光性樹脂の応用研究も活発に行なわれ現在 IC, LSI, プリント基板等の電子回路作成のためのフォトレジスト類、凸版、平版、平凹版、凹版等の印刷版材もしくはそれらのフォトファブリケーション用フォトポリマー、塗料やロビングの素材その他の広範囲に亘り実用に供されている。

ところで、感光材料を用いてレジストあるいはレリーフ画像等を形成する方法として、露光後溶剤または水溶液等を用いて画像を形成させる露式現像法と露光後カバーフィルムを剥離するだけで画像を形成させる乾式現像法(剥離現像法)が知られているが、近年、作業工程の簡便性や処理時間の短縮化等の利点から剥離現像法が注目されている。

本発明は、かかる剥離現像に好適な物性を有する感光性組成物であつて、しかも、露光に際

して酸素による光重合反応の阻害が極めて少なく、更には、耐薬品性の優れた画像を与える感光性組成物を提供することを目的とするものである。そして、その目的は、(a)主鎖または側鎖に桂皮酸基を有する光架橋型重合体30～95重量%、および、(b)重合可能なエチレン性不飽和結合を有する单量体70～5重量%を含有する感光性組成物によつて達成されるのである。

以下、本発明を説明するに、本発明の感光性組成物を構成する一成分は(a)主鎖または側鎖に桂皮酸基を有する光架橋型重合体(以下、「(a)成分」という)である。

主鎖に桂皮酸基を有する重合体としては、例えば、フェニレンジアクリル酸またはそのアルキルエステルとポリオールとの重縮合体が挙げられる。具体的には、1,4-フェニレンジアクリル酸と1,4-ジメタヒドロキシエトキシシクロヘキサンとの重縮合体、1,4-フェニレンジアクリル酸とトリエチレングリコール及び水添ビスフェノールAとの重縮合体、1,3-フェニ

レンジアクリル酸と1,4-ジメタヒドロキシエトキシシクロヘキサンとの重縮合体、2,5-ジメトキシ-1,4-フェニレンジアクリル酸と1,4-ジメタヒドロキシエトキシシクロヘキサンとの重縮合体、2-ニトロ-1,4-フェニレンジアクリル酸とジエチレングリコールとの重縮合体等が挙げられる。

側鎖に桂皮酸基を有する重合体としては、例えば、ハログン原子または水酸基を有する樹脂と桂皮酸またはその塩とのエステル化物、桂皮酸基を有する单量体の単独重合体あるいは他の单量体との共重合体が挙げられる。具体的には、ポリエビクロルヒドリン、ポリエビプロムヒドリン、ポリビニルアルコール等と桂皮酸またはそのアルカリ金属塩とのエステル化物、ビニルシジンナメート、グリシジルシジンナメート、メタヒドロキシエチルメタクリレートシジンナメート等の単独重合体あるいはそれらとアクリロニトリル、メチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、ステレン、塩化ビニル、酢酸ビニ

ル等との共重合体が挙げられる。

本発明においては、主鎖に桂皮酸基を有する重合体、特に、1,4-フェニレンジアクリル酸と水添ビスフェノールAおよびトリエチレングリコールとの重縮合物が好ましい。

本発明の感光性組成物を構成する他の成分は(b)重合可能なエチレン性不飽和結合を有する单量体(以下、「(b)成分」という)である。

具体的には、例えば、ベンタエリスリトールトリアクリレート、ジベンタエリスリトールベントアクリレート、ベンタエリスリトールテトラアクリレート、エチレンクリコールジアクリレート、グリセリントリアクリレート、1,2,4-ブタントリオールトリアクリレート、1,3-ブロバンジオールジアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオールジアクリレート、1,5-ベンタンジオールジアクリレート、ネオベンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールブロバントリアクリレート等のアクリル酸エステル類、ベンタエリスリトールジメタクリレート、

ジエチレングリコールジメタクリレート、ジグリセリンジメタクリレート、トリメチロールブロバントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、エチレンビスアクリルアミド、ヘキサメチレンビスアクリルアミド等のアクリルアミド類、エチレンビスマタクリルアミド、ヘキサメチレンビスマタクリルアミド等のメタアクリルアミド類、フタル酸ジアリル、アジビン酸ジアリル、マロン酸ジアリル、スマール酸ジアリル等のアリルエステル類、エチレンクリコールジビニルエーテル、グリセロールトリビニルエーテル等のビニルエーテル類、ジビニルアジペート、ジビニルフタレート等のビニルエステル類が挙げられる。その他アリルメタクリレート、N,N-ビス(メタクリロキシエチル)アクリルアミドの如く異種構造のエチレン結合を複数個有する化合物も本発明に好適に使用し得る。特に、アクリル酸エステル類およびメタクリル酸エステル類が好ましい。

上記(a)成分および(b)成分の使用割合は、使用目的に応じて異なるが本発明の特徴を好適に発揮し得る領域は(a)成分3の重量%ないし95重量%および(b)成分7の重量%ないし5重量%、好ましくは、(a)成分4の重量%ないし8の重量%および(b)成分6の重量%ないし20の重量%の範囲である。

本発明になる感光性組成物は前記(a)成分および(b)成分以外に種々の添加物を混合して用いることができる。特に光反応率向上の為にいわゆる増感剤や光反応開始剤と呼ばれる光反応促進剤を添加した方が有利である。光反応促進剤としては従来公知のものを用いれば良く、例えば、P.ジーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、1,8-ジメトキシアントラキノン、ターカロロアントラキノン、1,2-ベンズアントラキノン、2-第3ブチルアントラキノン、3-クロロベンズアントロン、6-ヒドロキシ-1-クロロベンズアントロン、2-ケト-3-メチル-1,3-ジアザベンズアントロン、2-ベンゾイ

ルメチレン-1-メチル-2-ナフトチアゾリン、ユージベンゾイルメチレン-1-メチル-2-ナフトチフゾリン、2,4,6-トリフエニルチアビリリユームパークロレート、2,4,6-トリフエニルビリリユームパークロレート、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾフェノン-2-リエタノールアミン系レドックス型光開始剤等を好適に使用し得る。光反応促進剤は感光性組成物中に0.1重量%ないし20の重量%、好ましくは、1重量%ないし10重量%用いると有利である。

本発明の感光性組成物には更に熱重合防止剤、酸化防止剤、可塑剤、着色剤、樹脂等を含有させることもできる。熱重合防止剤としては例えばハイドロキノン、パラメトキシフェノール、パラブロボキシフェノール、ビロガロール、 β -ナフトール等があり酸化防止剤としては2,6-ジ- α -ブチル-2-クレゾール、2,2'-メチレン-ビス-(4-メチル-6- α -ブチルフェノール)、4,4'-チオビス-(6- α -ブ

- 7 -

チル-3-メチルフェノール)、ジラウリルチオジブロビオネット等を挙げることができる。可塑剤、着色剤等は従来公知のものを使用目的に応じて添加すればよい。

本発明に用いられる感光性組成物は溶剤に溶解して感光液を調製しこれを適当な支持体に塗布乾燥することにより感光層として形成されるが使用目的に応じては別の支持体をその感光層上に積層して使用に供することができる。前記溶剤としては例えばアセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸ブチル、トルエン、キシレン、クロルベンゼン、トリクロルエチレン、トリクロルエチレン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルアセテート、ペントキソノ等が挙げられ、支持体としてはAl, Cu, Zn等の金属シート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、三酢酸セルロース、ポリアミド、ポリイミド等各種プラスチックフ

- 8 -

イルム、上質紙、アート紙、コート紙、剥離紙等のペーパー類を使用目的に応じて適宜使用することができる。

本発明の感光性組成物を使用して得られる感光材料は平版印刷版、凸版印刷版等の刷版の作成、電子回路作成の為のフォトレジスト類、その他画像記録材料として有用である。

以下実施例により本発明を具体的に説明するが本発明はこれら実施例により限定されるものではない。

なお実施例中で用いた露光条件は高圧水銀燈「ウシオ電機社製ユニバース UMH-3000」で光源距離65mmにて行つた。

実施例 1

1,4-フェニレンジアクリル酸ノモルに対し水酸ビスフェノールA 0.5モル、トリエチレングリコール0.5モルを共縮重合して得た還元比粘度0.18のポリエステル(以下ポリエステル[A]とする)4.0ダラびにペンタエリスリトールトリアクリレート(大阪有機化学工業社製)

6.0タより成る組成物をシクロヘキサン 8.0タに溶解し更にヨージベンゾイルメチレン-1-メチル- β -ナフトチアゾリン 0.5タ、銅フタロシアニン顔料 1.0タを添加して感光液を調製した。これをポリエチレンテレフタレートフィルム(膜厚 25 μm)にバーコーターを用いて繪布、乾燥し乾燥膜厚 5 μm とし、次いで電解エッティングにより砂目立てしあつ陽極酸化を施した砂目立てアルミニウムシート上に前記感光層面を合わせ加圧ロールにて積層し感光材料を作成した。ネガ画像フィルムをこれに密着し前述の露光条件下にて 4.5 秒間露光し更にネガ画像フィルムを取り除いて 5 秒間全面露光し、次いでポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところアルミニウムシート上にポジ画像が形成され平版刷版が得られた。

実施例 2

実施例 1において得られたポリエステル[A] 6.0タ、ペンタエリスリトールトリアクリレート 4.0タとした他は同様条件にて感光材料を作

- 11 -

あつた。

比較例 1 および 2

実施例 1において、ポリエステル[A]単独またはペンタエリスリトールトリアクリレート単独より成る組成物を使用する他は同様にして感光液を調製し、アルミニウムシート上に横層して感光材料を作成した。これらの感光材料を実施例 1 と同様に露光した後、ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところ、いずれも良好な画像が形成されなかつた。

実施例 4

1.4-フェニレンジアクリル酸と 1.4-ジ- β -ヒドロキシエチルシクロヘキサンとの等モル重結合反応によつて得られた還元比粘度 0.19 のポリエステル(以下ポリエステル[B]とする) 4.5タおよびペンタエリスリトールトリアクリレート 5.5タより成る組成物をシクロヘキサン 8.0タに溶解し更にヨージベンゾイルメチレン-1-メチル- β -ナフトチアゾリン 0.5タ、銅フタロシアニン顔料 1.0タを添加して感光液

特開昭56-161538(4)
成した。ポジ画像フィルムをこれと密着し 5 秒間露光の様、ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところ、露光層の画像露光部はフィルムと共に除かれアルミニウムシート上にはポジ画像が形成された。これを更に 4.5 秒間露光したところ画像は完全に硬化し平版刷版が得られた。画像は 150 線/インチを再現し充分な画像性を有していた。また石油系炭化水素溶媒を用いて耐薬品性を調べた結果実施例 1、実施例 2 で得られた刷版は共に 99% 以上の感光層保持率を有し秀れた耐薬品性を示した。

実施例 3

実施例 1においてヨージベンゾイルメチレン-1-メチル- β -ナフトチアゾリンに代え 6-ヒドロキシ-1-クロロベンズアントロン 0.25タおよびトリエタノールアミン 0.25タとした他は同様にして感光材料を作成した。次いで、実施例 1 と同様に露光した後、剥離現像した結果、良好な平版刷版が得られた。また、石油系炭化水素溶媒による耐薬品性は 99% で

- 12 -

を調製した。以下実施例 1 と同様にして感光材料を作成し、これを露光後ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところ、良好なポジ画像を有する平版刷版が得られた。

実施例 5

実施例 4 で得られた感光材料を実施例 2 と同様に露光した後ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところ、良好なポジ画像を有する平版刷版が得られた。

実施例 6

ポリエビクロルヒドリンと桂皮酸より脱塩酸的に縮合して得た側鎖に桂皮酸基を有する還元比粘度 0.32 のポリエーテル(以下ポリエーテル[C]とする) 6.0タおよびペンタエリスリトールトリアクリレート 4.0タをシクロヘキサン 8.0タに溶解し、更にベンゾインメチルエーテル 0.5タ、銅フタロシアニン顔料 1.0タを添加し以下実施例 1 と同様に感光材料を作成した。これを実施例 1 と同様な条件で露光した後、ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離した

- 13 -

-220-

- 14 -

ところ、良好なポジ画像を有する平版刷版が得られた。

実施例 7

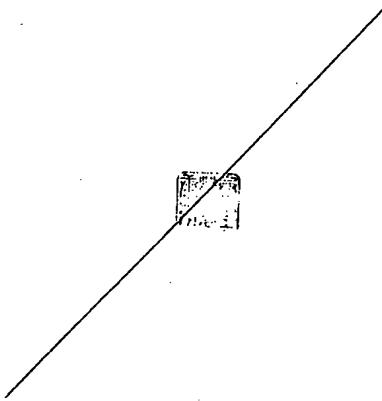
実施例 6 で得られた感光材料を実施例 3 と同様にして露光した後、ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離したところ、良好なポジ画像を有する平版刷版が得られた。

実施例 8

表 1 に示した組成物にユージベンゾイルメチレン-1-メチル- β -ナフトチアゾリン 5 wt%、鋼フタロシアニン顔料 10 wt% を添加、更に前記組成物の 8 倍重量のシクロヘキサンノンを加えて感光液を調製した。これを砂目立てしたアルミニウムシート上にホワラーを用いて乾燥膜厚 1.2 μm となる様に塗布した。これを真空フレーム中ならびに空気導通気下の両条件において感度測定を行なつた。感度はステップタブレット(イーストマンコダツク社製)を密着し前記露光条件にて 2.5 秒間露光した後、下記の現像液にて現像して感度を測定した。結果を

表 1 に示した。

現像液	アーブチロラクトン	75 wt%
	グリセリン	10 wt%
	アーオキシ酪酸	5 wt%
	リシン酸	5 wt%
	水	5 wt%



- 15 -

- 16 -

表 1

組成物		感度(段数)		
重合体	単體	単體重量分率	真空下	空気導通気下
ポリエステル[A]	ベンタエリスリトール トリアクリレート	0	7	7
		0.2	9	8.5
		0.3	9	9
		0.4	9	9
	トリメチロールプロパン トリメタクリレート	0	7	7
	0.2	10	10	
	0.3	10.5	10	
	0.4	10.5	10.5	
	1,4-ブチレングリ	0	7	7
	コールジアクリレート	0.2	9	9
	0.3	9.5	9	
	0.4	10	9	
ポリエーテル[C]	ベンタエリスリトール トリアクリレート	0	6	6
		0.2	6.5	6.5
		0.3	6.5	6.5
		0.4	7	6.5
	・	0	3	3
	0.2	5	4.5	
	0.3	5.5	6	
	0.4	6	6	
メチルメタクリレート・ メタクリル酸共重合体	・	0.3	4	0
		0.4	5	1

注 ポリエステル[D]:

2,5-ジメトキシ- α -エニレンジアクリル酸と 1,4-ジ- β -ヒトロキシエチルシクロヘキサンとの等モル重結合により得られた還元比粘度 0.85 のポリエステル

表 1 に示される様に桂皮酸含有重合体にアクリレートまたはメタクリレートを添加するに伴なつて感度が改善されることが判る。更に、空気導通気下での感度は真空下のそれとほど一致しており O_2 による光重合反応の阻害効果が排除されていることを示している。結合剤としてのメチルメタクリレート・メタクリル酸共重合体とベンタエリスリトールトリアクリレートから成る組成物を使用した場合、 O_2 により感度にして夫々光重合反応が阻害されていることが判つた。

出 製 人 三菱化成工業株式会社

代 埋 人 井垣士 長谷川 一

ほか/名

